(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2004 年3 月18 日 (18.03.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/023547 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/66

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/011165

(22) 国際出願日: 2003 年9 月1 日 (01.09.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-256744 2002 年9 月2 日 (02.09.2002) JP
特願 2002-336952
2002 年11 月20 日 (20.11.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社オクテック (OCTEC INC.) [JP/JP]; 〒160-0011 東京都 新宿区 若葉一丁目２２番地１－１０３ Tokyo (JP). 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目３番６号 Tokyo (JP).

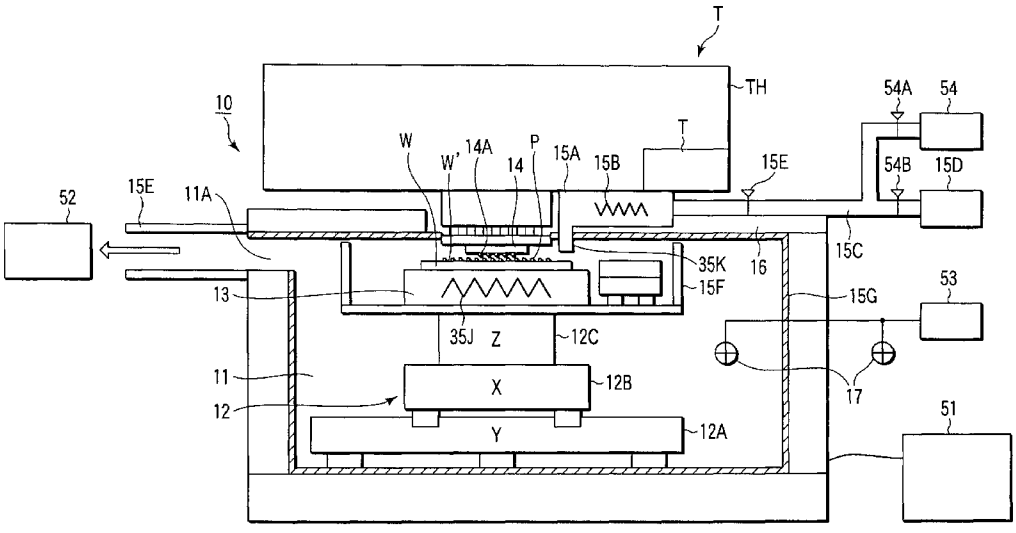
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 奥村 勝弥 (OKUMURA,Katsuya) [JP/JP]; 〒160-0011 東京都 新宿区若葉一丁目２２番地１－１０３ Tokyo (JP). 小松 茂和 (KOMATSU,Shigekazu) [JP/JP]; 〒407-8511 山梨県 韮崎市藤井町 北下条２３８１番地の１ 東京エレクトロンＡＴ株式会社内 Yamanashi (JP). 阿部 祐一 (ABE,Yuichi) [JP/JP]; 〒183-8705 東京都 府中市 住吉町２－３０－７ 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 古屋 邦浩 (FURUYA,Kunihiro) [JP/JP]; 〒407-8511 山梨県 韮崎市藤井町 北下条２３８１番地の１ 東京エレクトロンＡＴ株式会社内 Yamanashi (JP). ブザン バンソン (VEZIN,Vincent) [FR/JP]; 〒407-0192 山梨県 韮崎市穂坂町 三ツ沢６５０番地 東京エレクトロンＡＴ株式会社内 Yamanashi (JP). 久保 謙一 (KUBO,Kenichi) [JP/JP]; 〒407-0192 山梨県 韮崎市穂

[続葉有]

(54) Title: PROBING METHOD, PROBE, AND MECHANISM FOR REDUCING/PLASMA ETCHING ELECTRODE

(54) 発明の名称: プローブ方法、プローブ装置、及び電極の還元／プラズマエッチング処理機構



(57) Abstract: A probing method comprising a step for reducing the electrode of a wafer W using a forming gas, and a step for contacting a probe pin (14A) with the electrode in a dry atmosphere. Prior to reducing the electrode P of an article under inspection, the article is heated in an inert gas atmosphere and reduction is carried out by contacting a reducing gas with the electrode of the article under inspection under a normal pressure.

(57) 要約: 本発明のプローブ方法は、フォーミングガスを用いてウエハWの電極を還元処理する工程と、乾燥雰囲気下で電極とプローブピン１４Ａを接触させる工程とを備えている。 さらに、被検査体の電極Ｐの還元処理の前に、被検査体を不活性ガス雰囲気において、被検査体を加熱することを具備し、該還元処理は常圧下で還元性ガスを被検査体の電極に接触させることにより実施される。

WO 2004/023547 A1

坂町 三ツ沢６５０番地 東京エレクトロンＡＴ株式会社内 Yamanashi (JP).

(74) 代理人: 鈴江 武彦， 外(SUZUYE,Takehiko et al.); 〒100-0013 東京都 千代田区 霞が関３丁目７番２号 鈴榮特許綜合法律事務所内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。